30GHz帯を目指した磁性薄膜の高周波透磁率測定

武田 茂、直江正幸*、発知富夫**、本村貞美**、鈴木洋介** (Magnontech, *電磁研、**キーコム)

High Frequency Permeability Measurements of Magnetic Thin Films aiming at 30GHz Band

S. Takeda, M. Naoe*, T. Hotchi**, S. Motomura**, H. Suzuki**

(Magnontech, Ltd., *Res. Inst. for Electromagnetic Materials, **KEYCOM Corp.)

はじめに 我々は、遮蔽型短絡マイクロストリップ線路を用いて、10GHz までの磁性薄膜の高周波透磁率の 測定結果を報告した¹⁾。今回、さらなる高周波化を目指して、30GHz までの基礎検討を行ったので報告する。 **問題点と対策** 我々の測定原理である集中定数近似²⁾を用いて高周波化する場合の問題点を整理する。一つ は、電磁波の伝播方向の試料の電気的長さをλ/4以下にすることである。また、形状を正方形の形状のまま で小さくすると検出信号が下がる。TEM モードが維持され平面波が伝播するとすれば、その面内垂直方向の 寸法制限は緩い。そこで試料の一辺の長さだけ短くして、形状を長方形とした。さらに、基板体積由来の静 電容量の影響をできるだけ抑えるために、薄い基板を用いた。もう一つは、薄膜試料による微弱な信号強度 と同程度の細かい不要共振モードの雑音を如何に抑えるかということである。このため、測定治具の形状、 ストリップ線路の形状、多重反射を抑えるための吸収体の貼り付けなどを検討した。

実験方法 Fig.1 に測定治具の断面図を示す。ストリップ線路幅 *w*=3.24 mm,線路高さ *h*₁=0.8 mm, *h*₂=3.7 mm である。治具全体の共振の効果を見るために、長さ *l*=3 mm, 8 mm の二つの治具を用いた。試料には高異方性 のナノグラニュラー面内一軸異方性膜 ³を用い、その磁化困難軸の透磁率を測定した。試料形状は、2 mm× 10 mm の短冊試料とした。基板の厚みは、*d*=0.2 mm, 0.3 mm の 2 種類である。ゼロ点測定には、外部からマ イクロ波磁界と平行に 5kOe の静磁界を加えた(Field 法)。周波数掃引範囲は 0.1~30GHz である。

実験結果と考察 Fig.2 に *l*=8 mm 長治具を用いて測定した結果を、Fig.3 に *l*=3 mm 長治具を用いて測定した結果を示す。基板の誘電率と厚みはそれぞれ 6.4 及び 0.2 mm で、試料膜厚は 1.015 μ m である。Fig.2 に示すように、8 mm 長の治具を用いた場合は、20 GHz まではスムースな曲線が得られたが、それ以上では鋭い不要共振が見られ、測定不能であることが分かる。一方、Fig.3 の 3 mm 長治具を用いた場合は、20 GHz 以上の鋭い共振がなくなり、大幅に不要モードによる共振ノイズが軽減されているのが分かる。しかし、26 GHz にもブロードなピークが観測された。試料は不連続な異方性の強度分散を示しているが³⁾、このピークが膜の特性か否かは検討中である。いずれにせよ、今回の検討で 20 GHz まではスムースに測定できることが分かった。ここで、磁化 4 π M_sを実際の 9.3 kG とし、強磁性共鳴周波数 *f*_f と低周波における透磁率 μ 'との関係を、異方性磁界を変化させて計算すると、*f*=30 GHz→ μ '=2.32, *f*=20 GHz→ μ '=3.40, *f*=10 GHz→ μ '=8.64 である。 μ 'は 1+(4 π M_s/H_k)とした。そのときの H_kは、それぞれ 7034 Oe, 3876 Oe, 1216 Oe である。実際には、H_kが 1216 Oe であり、*f*=10 GHz、5GHz での μ 'は 8.0 であった。これらは上記計算結果と非常によく一致している。



参考文献

- 1) S. Takeda, et al., J. Magn. Soc. Jpn., 39, 227-231 (2015),
- 2) S. Takeda, et al., J. Magn. Soc. Jpn., 39, 116-120 (2015),
- 3) M. Naoe, et al., IEEE Magn. Lett., 5, #3700404 (2014)